

108 年度民專上字第 24 號附圖

附圖一：



圖 1 為系爭專利之一實施例的層系統

附圖二：

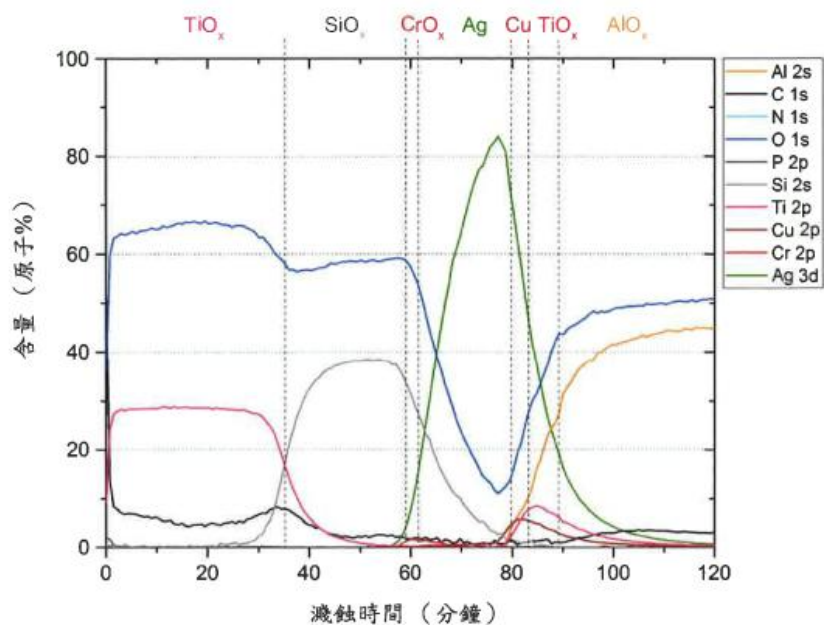


圖 2：利用 XPS 進行 M98AX17 之縱深分析
(元素組成與濺蝕時間之關係)
濺蝕時間：120 分鐘

表 1: (自頂層至基板) 層次序含各層組成之總結

層 1	TiO _x (接近化學計量)
層 2	SiO _x (接近化學計量)
層 3	CrO _x (亞化學計量)
層 4	Ag (金屬)
層 5	Cu (金屬)
層 6	TiO _x (亞化學計量)
層 7	AlO _x (接近化學計量)
基板	

附圖三：

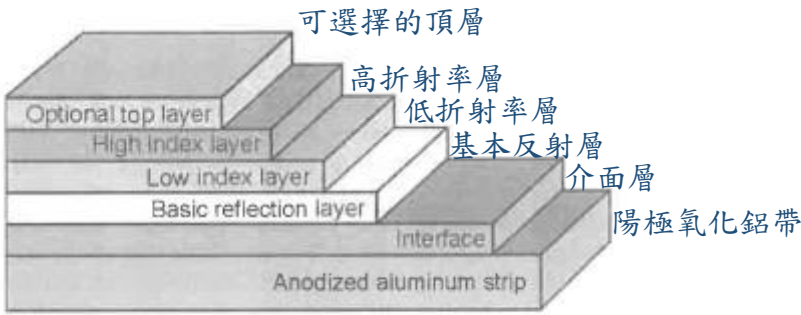


Figure 1: General structure of a reflection increasing layer stack.

反射增強層堆疊之通常結構

附圖四：

